科学研究費補助金研究成果報告書

平成21年6月1日現在

研究種目:基盤研究	(C)
研究期間:2007~2008	3
課題番号:19560	9 4 9 1
研究課題名(和文)	粘土のせん断抵抗係数tan φのメカニズムに関する研究
研究課題名(英文)	Research on mechanism of coefficient of shear resistance " $\tan \phi$ " of clay
研究代表者	
大河原 正文 (0)	(AWARA MASAFUMI)
岩手大学・工学部・	准教授
研究者番号:802	2 3 7 4 1

研究成果の概要:

せん断抵抗係数 tan φ は、土のせん断特性を表す強度パラメータのひとつで、地すべり安定 解析に用いられるなど、地盤防災に直接的に関わる重要なパラメータである. これまで tan φ の存在理由、すなわち、なぜ垂直応力の増加に伴ってせん断強さが増加するのかについて明確 な説明がなされていなかった.本研究の主な成果として、肉眼では密着しているようにみえる せん断面も、実際にはミクロ領域では接触部分と非接触部分が存在し、接触部分の面積が垂直 応力の増加に比例して大きくなることを明らかした.

交付額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2007年度	2,600,000	780,000	3, 380, 000
2008年度	1,000,000	300, 000	1, 300, 000
年度			
年度			
年度			
総計	3, 600, 000	1, 080, 000	4, 680, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:土木工学・地盤工学

キーワード: せん断強さ、物理化学、表面・界面、粘土鉱物、水、分子

1. 研究開始当初の背景

せん断抵抗係数 $\tan \phi$ は、垂直応力の増減 に対するせん断応力の増減率を表し、土のせ ん断特性を表す重要なパラメータのひとつ である. $\tan \phi$ はせん断強度の種類ごとに、 それぞれ $\tan \phi_p$ (ピーク状態)、 $\tan \phi_s$ (完全 軟化状態)、 $\tan \phi_r$ (残留状態)と表記される. ここでピーク状態とは、過圧密粘土の最大せ ん断強さを発揮しているときの状態で、通常、

せん断強さといえばこの状態のせん断強さ を示している.完全軟化状態とは、練り返し た粘土を正規圧密してせん断したとき最大 せん断強さのことで、残留状態とは、大きな せん断変位後に強度が定常状態に至った時 点の状態をさす.残留強度は、応力履歴やせ ん断速度の影響をほとんど受けず粘土鉱物 の種類ごとに一定値に収束することが知ら れている. せん断抵抗係数 tanφは、土質力 学において最も重要な強度パラメータであ るにもかかわらず、tanφの存在理由、すな わち、なぜ垂直応力の増加に伴ってせん断強 さが増加するのかについて明確な説明がな されていない. ところで、T. Mitachi、T. Kuda、 M. Okawara et al. (2003)は、残留状態でのせ ん断抵抗係数 tan ϕ_r が現在のところもっと も真の値に近いと考えられているボルスレ フのせん断抵抗係数 tan ϕ_e に等しいことを 理論的に導いており、このことは(tan ø =tan ↓,)、種々あるせん断強度のなかで残留強度 の理解が、真のせん断強さとは何かを説明す る上で核心であることを示している.

2. 研究の目的

本研究の目的は、粘土のせん断抵抗係数 "tan ()"のメカニズムを解明することであ る.具体的には、以下の4点について研究し た.

(1) せん断面の真実接触面と tan φ との関係 (2) せん断面に存在する水の物性 (3) せん断強度と粘土鉱物の電荷との関係 (4)メソメカニズム (ミクロをマクロにつなげ るメカニズム)

3. 研究の方法

(1) せん断面の真実接触面積とtan φ との関係 ①AFM(原子間力顕微鏡)によるせん断面の 表面形状測定

残留状態でのせん断面(以後、残留状態せ ん断面)を、大変位一面せん断試験装置によ り作製し(圧密定圧条件、垂直応力150k Pa、せん断変位量200mm、せん断速度0. 5mm/min)、AFMによりせん断面の表面粗 さならびに表面凹凸測定を行った.使用した AFM は、DI 社製 Dimension3000(写真 1) で、測定範囲は10×10µm、使用したプロー ブはNCH (ナノワールド社)、測定モードは タッピングモードである.得られた凹凸デー タから、表面粗さパラメータ「算術平均高さ R」、「表面積増加率 RIA」を算出した.算術 平均高さRは、JISによると「粗さ曲線から、 その平均線に基準長さ1だけ抜き取り、この 抜き取りの部分の平均線から測定曲線まで の偏差の絶対値を合計し、平均した値」と規 定されている.図1に算術平均高さRの概念 図を示す.表面積増加率 RIA は、測定範囲に おけるうねりの大きさを捉えるものである. これら2つのパラメータから粘土の残留状態 せん断面の表面粗さを定量的に評価した.



写真1 AFM(原子間力顕微鏡)



②CLSM(共焦点レーザー顕微鏡)による せん断面のその場観察

せん断面の接触部分を共焦点レーザー顕 微鏡(Confocal Laser Scan Microscope、以 後 CLSM、バイオラッド社製、MRC-1024、写 真2)により観察した. 観察面は、スライド ガラス上のせん断面である. つまり観察面は スライドガラスとせん断面との接触部分と いうことになる. CLSMとは、レーザーを 対象物に照射し、そこから反射した光ないし 放出された蛍光を検出してコンピュータで 画像化する,特徴は、ピンホールと呼ばれる 絞りを利用することで同一焦点(共焦点)面 だけの反射光、蛍光を検出するため、任意の 面の鮮明な光学平面・断面像を得ることがで きる点にある (図 2). 観察にあたりCLSM の焦点をスライドガラスの上面に合わせ、ガ ラスとせん断面との接触部を詳細に観察し た. また、垂直荷重との関係については、試 験後の供試体を加圧試験機にセットし、荷重 を増加させながらCLSMで観察した(図3). このとき荷重によるガラス自体のたわみを 極力少なくさせるために強化ガラスを用い た.



写真2 CLSM (共焦点レーザー顕微鏡)



図2 CLSMの測定原理と界面の観察方法



(2)粘土粒子表面に存在する水の物性 ①AFMによる粘性測定

せん断面上の水の物性を調べるためにA FMによる粘土表面の粘性測定を行った.粘 性はAFMのプローブ(探針)の位相遅れに より測定される.図4は粘性の異なる物質を 測定したときの位相差を模式的に表したも のである.粘性が高い物質ほど位相が遅れる. 測定範囲は10×10μm、プローブはNCH(ナ ノワールド社製)を使用し、測定モードはタ ッピングモードである.一般に粘性は温度依 存性を示すため、温度との関係についても検 討した.すなわち、測定時のステージの表面 温度を 20℃、25℃、30℃、35℃、40℃に設 定し粘性を測定した.基盤には清浄なシリコ ンウエハを用い、粘土に蒸留水を加えて撹拌 したものを試料の厚さに注意してシリコン ウエハに擦りつけ室温で乾燥させたものを 供試体とした.測定手順は、試料ステージに 取り付けた試料にプローブを近づけて探針 をスキャンし、スキャン開始直後1スキャン ラインで固定した状態で往復の凹凸波形お よびエラー波形が一致するようにパラメー タを調整した.調整後、10µm×10µmの範 囲をスキャンさせ凹凸像および位相像を得 た.粘土とシリコンウエハとの位相差は画像 解析により位相遅れのヒストグラムとして 表される.



②分光学的手法による水の結合力測定 せん断面上の水の分光学的特性をフーリ 工変換型顕微分光装置(日本分光 VIR-9500、 IRT-30、以後、顕微 FTIR、写真 3) により 調べた. 測定は、試料表面にプリズムを密着 させる ATR 法(全反射法)によった. 顕微 FT-IR は試料表面の局所分析、微量、微小試 料の測定に威力を発揮し、本実験での測定範 囲は d 250 um、 測定 深度は 250 nm~2000 nm である.測定においては、まず試料のない状 態でバックグラウンド測定を行い、次いでせ ん断面を ATR 装置のプリズムに密着させて 赤外スペクトルを測定した. このとき、試料 の下部に取り付けた小型圧力計で試料表面 とプリズムとの接触圧を測定した(図5).測 定波数域は中赤外領域 4000~400cm⁻¹、測定 時の分解能は4 cm⁻¹、積算回数は 87 回であ る. また、自然乾燥させた試料の顕微反射測 定を行った. 試料はアルミ板上に平らにセッ トし、その表面に赤外線を反射させ赤外スペ クトルを測定した.



写真3 フーリエ変換型顕微分光装置



図5 ATR による試料接触圧測定の概要

(3)せん断強度と粘土鉱物の電荷との関係 ①陽イオン交換容量(CEC)測定

粘土試料の電荷を CEC により求めた. C EC測定は、平衡法に準拠した方法で行った. 試料約 100 mgを蓋付遠心管に入れ、0.5mol/I の塩化カルシウム溶液で5回洗浄し陽イオン で飽和した後、0.01mol/lの塩化カルシウム 溶液で5回洗浄し、平衡濃度とした.最後の 洗浄の上澄み液を平衡溶液とし、遠心管を秤 量し湿潤試料とした. 最後に 1mol/l の塩化ア ンモニウム溶液で5回洗浄した.この上澄み 液を 50ml のメスフラスコに集積し蒸留水で 50ml に定容したものを測定溶液とした.遠 心管は蒸留水とエタノールの1:1混合溶液、 エタノールのみ、エタノールとアセトンの 1:1混合溶液で各1回ずつ洗浄し、110℃で 20時間炉乾燥したものを乾燥重量とした.原 子吸光光度計で測定溶液と平衡溶液のイオ ン濃度を測定し、測定されたイオン濃度から CEC を算出した.

(4)メソメカニズム

(1)~(3)の結果に基づきミクロ強度 とマクロ強度を結びつけるメカニズム(メソ メカニズム)について考察した. 4. 研究成果

(1)せん断面の真実接触面とtan φ との関係
①AFM によるせん断面の表面形状

図6にクニピアF、カオリンKH、NSF粘土 の残留状態せん断面の凹凸像、断面画像、3 次元凹凸像を示す.なお、中段の断面画像の 断面位置は上段凹凸像の直線部である.表1 に表面粗さRa、算術平均高さRおよび表面 積増加率RIAを示す.いずれのせん断面も表 面に凹凸が確認され、粗さの程度はクニピア F<カオリンKH<NSF粘土であった.



図6 せん断面のAFM像

表1 残留状態せん断面の表面解析結果

kunipia-F		kaolin-KH		NSF-clay	
Ra (nm)	RLA (%)	$R_a \ (nm)$	RIA (%)	$R_{a}\left(nm\right)$	RIA (%)
47.58	0.69	191.70	19.92	232.04	20.11
46.69	0.68	154.07	33.76	283.68	33.67
49.57	0.70	114.68	14.08	275.47	38.60

②CLSM によるせん断面のその場観察

図7は加圧試験機により垂直応力を載荷した ときのせん断面とスライドガラスとの接触部 の平面像である. ガラスとせん断面を構成す る粘土粒子が接触していると白色に見える. 図より白色と黒色の明暗の模様が分布して いることが分かる.このことからせん断面と ガラスは全面で接触しているのではなく部 分接触である.また、垂直応力を $\sigma_v = 0$ kPa、 24.0kPa、 47.7kPa、 98.4kPa と段階的に増加さ せるのに伴って全体的に白色が増している様 子が認められる. 接触部分の面積率を算出する ために白と黒に二値化して総面積における白 色域の占める割合を算出した(表2、図8). 垂 直応力の増加に伴って白色域の面積率が増 加している. 白色域の面積増加は、粘土粒子 とスライドガラスとの接触面積すなわち真 実接触面積の増加を示している.









(2)粘土粒子表面に存在する水の物性 ①AFMによる粘性測定

図9にクニピアF、クニボンド、カオリン KH および勝光山パイロフィライトの位相像 を示す.図中に温度とスキャン速度(Scan Rate:SR)を示す.図において、白色部分は 粘土粒子で黒色部分はシリコンウエハであ る.粘土粒子とシリコンウエハの境界部分で 白色部分が最も明るい.図10は位相遅れの ヒストグラムである.シリコンウエハの位相 遅れは、温度に関係なくほぼ0°(粘性ゼロ) であるため、得られた位相差はそのまま粘土 の粘性を表している.表3は温度ごとの粘土 粒子表面とシリコンウエハとの位相差であ る. 表から全ての粘土において温度上昇に伴い位相差が減少している. 位相差の減少は粘性の低下を示す. したがって、粘土粒子表面の粘性は温度上昇に伴い低下している. 10℃の温度上昇に伴う粘性の低下割合はクニピアFで平均3.7°、クニボンドで平均5.7°、 カオリンKHで平均13.7°、勝光山パイロフィライトで平均28.0°である.





図 10 位相遅れのヒストグラムとピーク値

表3 粘土とシリコンウエハとの位相差(湿度90%)

試料名	20°C	30°C	40°C
クニピア F	102.5°	99.3°	95.2°
クニボンド	95.2°	89.1°	83.8°
カオリン KH	110.4°	92.3°	83.0°
勝光山パイロフィライト	129.8°	105.3°	73.9°

②分光学的手法による水の結合力測定

図 11 に NSF 粘土に対して ATR プリズム の接触圧を 10kPa~40kPa に変化させた時 の赤外スペクトルを示す.3400cm⁻¹付近の幅 広いピークは NSF 粘土のせん断面付近の吸 着水の OH 伸縮振動である.NSF 粘土は、 接触圧の増加に伴い吸着水の OH 伸縮振動の 吸光度が減少している.図 12 はスメクタイ トに対して ATR プリズムの接触圧を変化さ せた結果であるが、吸着水・層間水の OH 伸 縮振動の変化は認められなかった.以上より、 接触圧の増加に伴い NSF 粘土は脱水し、ス

メクタイトの水は脱水せずに強く吸着して いることが明らかになった.

さらに、偏光スペクトルの吸光度の変化から、 スメクタイトの 3400cm⁻¹ 付近のピークの水 分子の配向が示唆される. この 3400cm⁻¹付 近の水分子が水素結合の影響による高波数 シフトと考えると、配向している水分子は水 素結合が弱い、または水素結合を切って配向 していると推定される.



赤外スペクトル

(3) せん断強度と粘土鉱物の電荷との関係 ①CEC(陽イオン交換容量)測定

表4に CEC 測定結果を示す. スメクタイ トの CEC 値は、105.4 meg/100g、カオリン 鉱物の CEC 値は 9.2 meg/100g と極めて小さ る.

表4 粘土鉱物の pH、 CEC :	測定結
--------------------	-----

半十余物	CEC	pН	
柏工弧初	(meq/100g)		
スメクタイト	105.4	7.8	
カオリン鉱物	9.2	4.9	

(4)メソメカニズム

実験結果より、せん断抵抗係数 tan o の存 在理由、すなわち垂直応力の増加に伴うせん 断強さの増加理由については、肉眼では全面 接触しているように見えるせん断面も、実は 部分的に接触しているにすぎず、その接触面 積(真実接触面積)が垂直応力の増加に伴っ

て大きくなるためと結論づける.

5. 主な発表論文等

[学会発表] (計10件)

①大河原正文、倉谷昌臣、三田地利之、赤外 分光法による粘土鉱物中の水の状態分析、第 43 回地盤工学研究発表会、2008.7.10、広島· 国際会議場 ②久常雄大、<u>大河原正文</u>、三田地利之、原子 間力顕微鏡による高純度粘土の積層数・摩擦 力・粘性の測定、第43回地盤工学研究発表 会、2008.7.10、広島・国際会議場 ③太田征志、大河原正文、鈴木映一、分子軌 道法による粘土の吸着水の構造最適化と結 合エネルギー計算、第43回地盤工学研究発 表会、2008.7.10、広島·国際会議場 ④大河原正文、粘土の残留状態における強度 パラメータ (cr、 φr) のメカニズムに関 する研究、地盤工学会北海道支部第48回年 次技術報告会、2008.2.5、札幌 ⑤久常雄大、<u>大河原正文</u>、三田地利之、 S.B. Tamrakar、原子間力顕微鏡による高純度 粘土の異なる温度条件下での摩擦力・粘性係 数、地盤工学会北海道支部第 48 回年次技術 報告会、2008.2.5、札幌 ⑥大河原正文、三田地利之、鈴木映一、太田 征志、S.B. Tamrakar、Gaussian03 による 2:1 型粘土鉱物-水分子間の結合エネルギ-、第 51 回粘土科学討論会、2007.9.13、札幌、北大 ⑦久常雄大、大河原正文、三田地利之、原子 間力顕微鏡による粘土の摩擦力測定、第 51 回粘土科学討論会、2007.9.13、札幌、北大 (8)<u>Masafumi OKAWARA</u>, Takehiro HISATSUNE, Toshiyuki MITACHI, Physico-chemical on mechanism of the coefficient of shear resistance at the residual state " $\tan \phi$ " of clay、 International geotechnical symposium" Geotechnical engineering for disaster prevention & reduction" 2007.7.27, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia. ⑨大河原正<u>文</u>、三田地利之、大久保幸倫、粘 土の残留状態におけるせん断抵抗係数 tan φ rのメカニズム、第42回地盤工学研究発表会、 2007.7.5、名古屋国際会議場 ⑩久常雄大、大河原正文、三田地利之、原子 間力顕微鏡による膨潤性粘土鉱物のミクロ 摩擦力・粘性の温度依存性、第 42 回地盤工 学研究発表会、2007.7.5、名古屋国際会議場

6. 研究組織 (1)研究代表者 大河原 正文 (OKAWARA MASAFUMI) 岩手大学・工学部・准教授 研究者番号:80223741